

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成23年7月14日(2011.7.14)

【公開番号】特開2010-26040(P2010-26040A)

【公開日】平成22年2月4日(2010.2.4)

【年通号数】公開・登録公報2010-005

【出願番号】特願2008-184643(P2008-184643)

【国際特許分類】

G 0 2 F 1/1368 (2006.01)

G 0 2 F 1/1343 (2006.01)

G 0 2 F 1/1337 (2006.01)

【F I】

G 0 2 F 1/1368

G 0 2 F 1/1343

G 0 2 F 1/1337 5 0 0

【手続補正書】

【提出日】平成23年5月26日(2011.5.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に、互いに交差するように設けられた走査線及びデータ線と、
前記データ線に電氣的に接続されたトランジスタと、
画素領域に前記トランジスタと第 1 コンタクトホールを介して電氣的に接続される第 1 電極と、
前記画素領域の周辺に位置する周辺領域に設けられた第 2 電極と、
前記第 2 電極と第 2 コンタクトホールを介して電氣的に接続されており、前記第 2 電極に所定の電位を供給する電位供給線と、
前記第 1 電極及び前記第 2 電極を覆うように設けられた配向膜とを備え、
前記第 1 コンタクトホール及び前記第 2 コンタクトホールは、前記基板上で平面的に見て、所定方向に沿って夫々形成されていることを特徴とする電気光学装置。

【請求項 2】

前記所定方向は、前記基板上で平面的に見て、前記走査線又は前記データ線の延在する方向であることを特徴とする請求項 1 に記載の電気光学装置。

【請求項 3】

前記所定方向は、前記基板上で平面的に見て、前記走査線及び前記データ線と夫々交差する対角方向であることを特徴とする請求項 1 に記載の電気光学装置。

【請求項 4】

前記第 2 電極は、前記周辺領域に複数設けられていると共に、少なくとも部分的に、互いに電氣的に接続されていることを特徴とする請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の電気光学装置。

【請求項 5】

前記第 2 コンタクトホールは、前記基板上で平面的に見て、前記第 1 コンタクトホール

より小さいことを特徴とする請求項 1 から 4 のいずれか一項に記載の電気光学装置。

【請求項 6】

前記第 2 コンタクトホールは、前記基板上で平面的に見て、前記第 1 コンタクトホールと同じ大きさであることを特徴とする請求項 1 から 4 のいずれか一項に記載の電気光学装置。

【請求項 7】

前記第 2 コンタクトホールは、前記基板上で平面的に見て、前記第 1 コンタクトホールと同じ形状であることを特徴とする請求項 1 から 6 のいずれか一項に記載の電気光学装置。

【請求項 8】

請求項 1 から 7 のいずれか一項に記載の電気光学装置を備えることを特徴とする電子機器。

【請求項 9】

基板上に、互いに交差するように走査線及びデータ線を設ける配線工程と、

画素領域において、前記データ線に電氣的に接続されたトランジスタ及び第 1 電極を、第 1 コンタクトホールを介して互いに電氣的に接続する第 1 接続工程と、

前記画素領域の周辺に位置する周辺領域において、所定の電位を供給する電位供給線及び第 2 電極を、第 2 コンタクトホールを介して互いに電氣的に接続する第 2 接続工程と、

前記基板上に形成された配向膜に、所定の方向にラビング処理を施すラビング工程とを含み、

前記第 1 コンタクトホール及び前記第 2 コンタクトホールは、前記基板上で平面的に見て、前記所定の方向に沿って夫々形成される

ことを特徴とする電気光学装置の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

本発明の電気光学装置は上記課題を解決するために、基板上に、互いに交差するように設けられた走査線及びデータ線と、前記データ線に電氣的に接続されたトランジスタと、画素領域に前記トランジスタと第 1 コンタクトホールを介して電氣的に接続される第 1 電極と、前記画素領域の周辺に位置する周辺領域に設けられた第 2 電極と、前記第 2 電極と第 2 コンタクトホールを介して電氣的に接続されており、前記第 2 電極に所定の電位を供給する電位供給線と、前記第 1 電極及び前記第 2 電極を覆うように設けられた配向膜とを備え、前記第 1 コンタクトホール及び前記第 2 コンタクトホールは、前記基板上で平面的に見て、所定の方向に沿って夫々形成されている。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0039

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0039】

本発明の電気光学装置の製造方法は上記課題を解決するために、基板上に、互いに交差するように走査線及びデータ線を設ける配線工程と、画素領域において、前記データ線に電氣的に接続されたトランジスタ及び第 1 電極を、第 1 コンタクトホールを介して互いに電氣的に接続する第 1 接続工程と、前記画素領域の周辺に位置する周辺領域において、所定の電位を供給する電位供給線及び第 2 電極を、第 2 コンタクトホールを介して互いに電氣的に接続する第 2 接続工程と、前記基板上に形成された配向膜に、所定の方向にラビング処理を施すラビング工程とを含み、前記第 1 コンタクトホール及び前記第 2 コンタクト

ホールは、前記基板上で平面的に見て、前記所定の方
向に沿って夫々形成される。